

2010年12月1日

各位

会社名：昭和電工株式会社
代表者名：取締役社長 高橋恭平
(コード番号：4004)
問合せ先：IR・広報室長 皆川 修
Tel. 03-5470-3235

中期経営計画(2011～2015年)『PEGASUS (ペガサス)』の概要

— 進化する個性派化学を目指して—

昭和電工株式会社(社長：高橋 恭平)は、2011年からスタートする新中期経営計画『PEGASUS (ペガサス)』(以下、『ペガサス』)を策定いたしました。2008年後半からの事業環境の激変に対し、当社は2006年にスタートした3年間の中期経営計画「プロジェクト・パッション」を2年間延長し、2009～2010年を「パッション・エクステンション」として大胆な事業構造改革を進めてまいりました。不採算事業からの撤退、大幅なコスト削減策の実施、基盤事業の収益性強化を推進し、本年は業績のV字回復を果たしたことから、2011年より新たな中期経営計画をスタートすることといたしました。当社は『ペガサス』において、個性派化学をさらに進化させ、強力かつ多様な事業群をグローバル展開することにより各市場におけるリーディングポジションの確立を目指します。

1. 『ペガサス』のコンセプトと基本戦略

(1) コンセプト

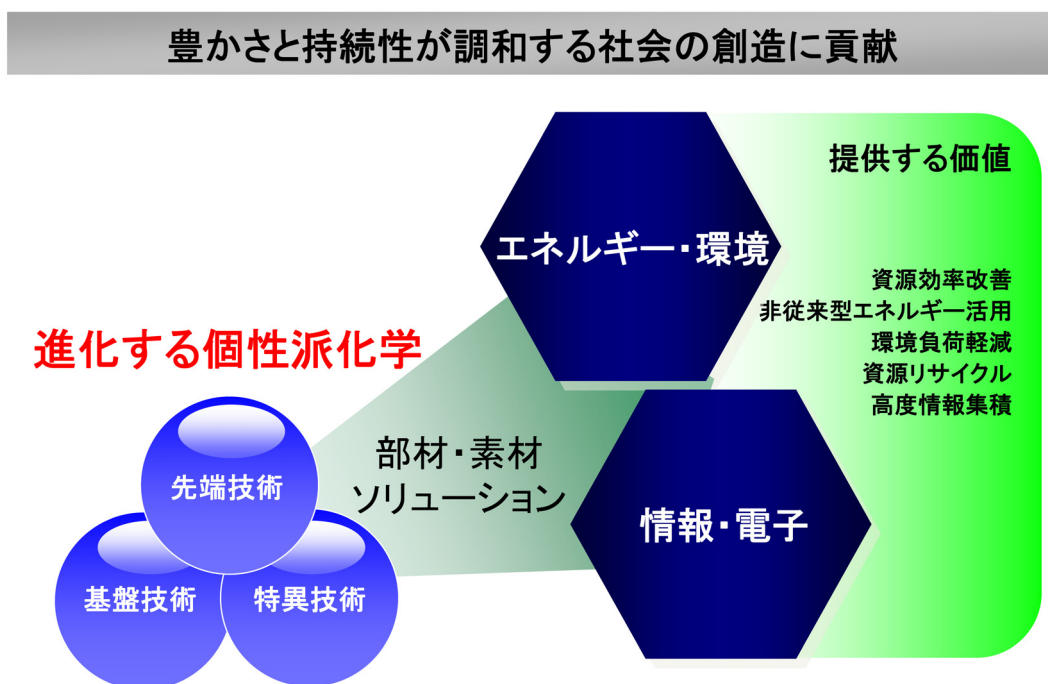
新興国において急速な経済成長により生活水準が上昇する一方で、地球環境への負荷増大を抑制するための取り組みが世界全域で求められています。社会動向を市場性の観点から見た場合、電子産業分野の一層の高品位化・高速化・高容量化・小型化の進展による利便性・快適性の向上、地球温暖化対策・環境保全の推進による健康で安全な社会の実現、化石エネルギー依存度低下・省エネルギー推進によるエネルギー供給保障等の人類共通の諸課題に対応するための新技術の開発と事業化が求められています。

当社は、このような地球規模の市場ニーズに対応するため「エネルギー・環境」と「情報・電子」の2つの事業ドメインを設定しました。(図1)当社固有かつ優位性のある技術をベースに先進・先端技術領域をリードする部材・素材・ソリューションをお客様に提供し、豊かさを持続性が調和する社会の創造に貢献してまいります。

(2) 基本戦略

目指す事業ポートフォリオにおいて、各事業を「基盤(成長)」、「基盤(安定)」、「成長・育成」の3つに区分し、グローバル競争力のある事業に集中して経営資源を配分する成長戦略を遂行いたします。(図2)

(図 1) 2つの事業ドメイン



①主力事業

ハードディスクと黒鉛電極を主力事業と位置づけ、この2事業に対しては生産能力の増強も含めて、積極的な拡大戦略をとります。同時に当社における収益・キャッシュフロー創出の柱とします。

②育成・成長事業

半導体高純度ガスや各種機能材料等の成長事業の早期拡大を図り、またリチウムイオン電池等の材料、パワー半導体 SiC、および耐熱透明フィルムなどアリル系誘導品等の新規事業の育成を加速します。

③海外戦略

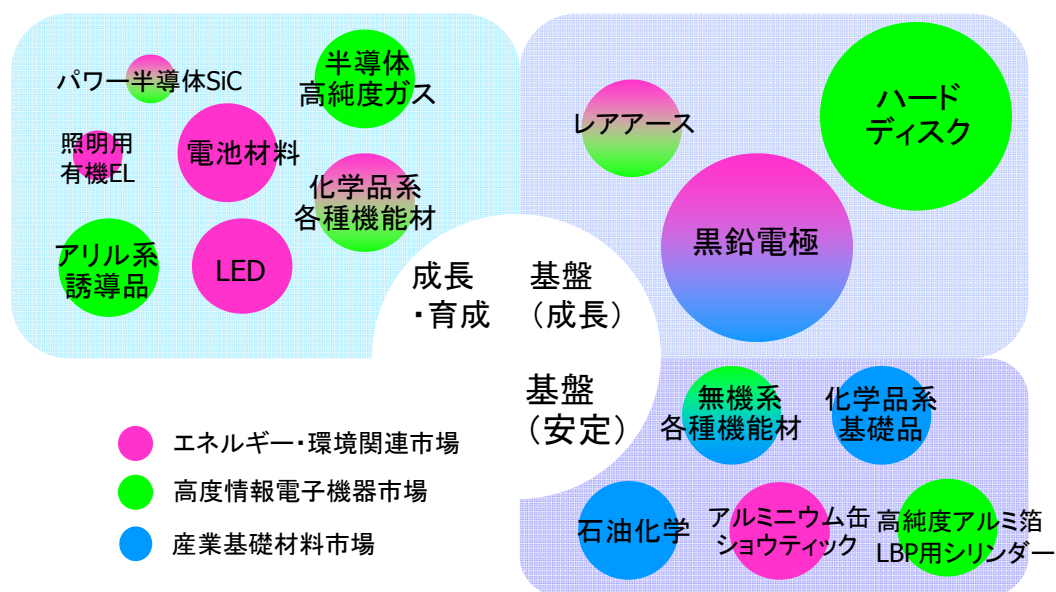
アジアを中心とする成長市場において事業拡大を積極的に進めます。主力事業であるハードディスク、黒鉛電極の他、レアアース磁石用合金、コンデンサー用高純度アルミ箔、LBP用シリンダーといった事業においてもさらに海外展開を加速します。

④M&A、パートナーシップの活用

現有経営資源に加えて、事業戦略・研究開発の遂行上必要な M&A やパートナーシップ等を積極的にすすめ、事業化のスピードアップを図ります。

『ペガサス』において当社は、2013年の営業利益目標を800億円とし、フリー・キャッシュ・フローについては400億円を目指します。

(図 2) 目指す事業ポートフォリオ



2. 個別事業戦略 (ハイライト)

(1) ハードディスク

ハードディスクドライブ (HDD) の需要は、新興国を中心にノート PC の高成長が持続すること、また、クラウドコンピューティングの普及等世界的な情報処理量増大によるデータセンター向けの高容量サーバー需要の伸びも予想されることから、今後も年間 10%程度の成長が見込まれています。さらなる市場の拡大に対し、当社はシンガポール拠点を中心とする生産能力増強と既存設備の能力最大化を推進します。また、ハードディスクの高容量化ニーズに対しても、当社は PMR (垂直磁気記録) 方式第 6 世代の早期量産化に続き、SWR (Shingled Write Recording、瓦書き記録) 方式等次世代技術への対応を着実に進め、高容量化技術において業界のリーディングポジションを確保してまいります。

(2) 黒鉛電極

電炉鋼は、鉄資源リサイクル、低環境負荷の観点から重要度が増しており、新興国を中心に世界の生産量は 2015 年まで年 6%程度の成長が見込まれています。当社は、電炉鋼生産で使用される黒鉛電極において特に高付加価値の超大口径電極の世界シェアで 40%を持つトップメーカーですが、今後、新興国が牽引し世界的に電炉鋼需要の増大が予想されることから、米国拠点における生産能力増強および第 3 の生産拠点の設置についての検討をすすめる、事業規模の拡大を図ります。原料ニードルコークスについても安定確保に積極的に努め、能力増強を確実にすすめるとともに、生産技術をさらに強化し、品質、コスト両面において世界トップレベルを維持します。

(3) 半導体高純度ガス

半導体、液晶パネル、LED、太陽電池パネル等のエレクトロニクス産業はアジア諸国を中心に急速に成長・発展しており、同分野向けの特殊高純度ガスの需要拡大を受けて、当社

は既に中国、台湾、韓国、シンガポールに半導体高純度ガス供給拠点を設置し、事業を拡大してまいりました。半導体高純度ガス市場は、今後も酸化膜、窒化膜等の成膜プロセス分野での需要増大が見込まれることから、当社はアジアの供給拠点の拡充・強化を積極的に推進し、プレゼンスのさらなる拡大を図ります。また、セレン化水素等の太陽電池向け製品群の早期事業化をすすめるとともに、次世代高純度成膜材料ガス等の新製品の開発を積極的にすすめてまいります。

(4) LED

高輝度 LED 市場は、液晶テレビ用バックライトや照明用途を中心に着実に伸長し、2015 年には 1.3 兆円の巨大市場に成長すると予想されています。当社は、GaN チップ事業においては生産性向上と効率化を追求し、コスト競争力の強化に努めます。さらに、当社独自技術である「ハイブリッド PPD™」法を生かした大口径 GaN 系エピタキシャルウエハの事業化を図ります。当社が強みをもつエピタキシャル技術をコア領域として拡充強化し、事業拡大を目指します。

3. 研究開発戦略

2011 年から 2015 年の 5 年間に研究開発費として総額 1,200 億円を投資いたします。事業の成長・強化に直結する研究開発を長期的に推進し、基盤（成長）事業と成長事業には全体の 6 割を、探索・育成テーマには 2 割を配分いたします。なお、以下の重点 4 テーマについて研究開発を加速し、早期事業化を目指します。

- (1) 先端電池材料：LIB 用電解質・電解液開発を推進し、2012 年までに電気自動車向けの技術を確立、2015 年の実装を目指します。
- (2) パワー半導体 SiC：高品質 SiC エピタキシャルウエハの安定供給体制を早期に確立し、中・高耐圧ニーズに確実に対応してまいります。
- (3) 耐熱透明フィルム：2011 年にパイロット設備を稼働させ、早期の事業化を目指してマーケティングを加速します。
- (4) 照明用有機 EL：2015 年までに寿命 4 万時間・発光効率 80 ルーメン／ワットを達成し、照明機器への採用を目指します。

4. 計数計画

(1) 全社計数計画

(億円)

	2011 計画	2012 計画	2013 計画	2015 イメージ
売 上 高	8,800	9,300	10,000	11,000
営 業 利 益	450	620	800	1,100
営 業 利 益 率	5%	7%	8%	10%
F C F	2011～2013年の累計で700			500
R O A			7%	10%

(2) セグメント別計数計画

(億円)

		2011	2012	2013
石油化学	売上高	2,500	2,600	2,700
	営業利益	50	65	90
化学品	売上高	1,300	1,400	1,600
	営業利益	70	100	130
エレクトロニクス	売上高	2,000	2,200	2,350
	営業利益	250	320	330
無機	売上高	900	1,000	1,100
	営業利益	105	165	230
アルミニウム	売上高	1,200	1,150	1,200
	営業利益	70	75	90
その他	売上高	900	950	1,050
	営業利益	▲95	▲105	▲70
合計	売上高	8,800	9,300	10,000
	営業利益	450	620	800

(注)上表のセグメント表示は、社内の事業組織に則った分類方法(マネージメント・アプローチ)を採っています。現行のセグメント表示から変更された主な点は次のとおりです。

- 1)「石油化学」の旧昭和高分子㈱の事業を「化学品」へ変更
- 2)卸供給電力事業を「アルミ他」から「化学品」へ変更
- 3)半導体高純度ガス事業を「電子・情報」から「化学品」へ変更
- 4)昭光通商㈱の事業を、各事業セグメントへの配賦から「その他」へ変更

(3) 設備投資計画

2011年から2013年の3年間に総額2,200億円の設備投資を行います。セグメント別には、主力のハードディスク及びレアアース磁石用合金等の事業を有するエレクトロニクス、能力増強を積極的に検討する黒鉛電極を主とする無機、アジア拠点の強化を行う半導体高純度ガスを含む化学品に重点的に投資いたします。

以上

◆本件に関するお問い合わせ先：IR・広報室 03-5470-3235